

## 公司发展历程

- 2004.05. 中国大连 FAB 工厂竣工
- 2003.08. 设立香港销售法人
- 2003.03. 设立中国深圳办事处
- 2002.10. 光电子（大连）有限公司  
增设生产车间
- 2002.07. 设立新加坡当地法人
- 2002.06. 设立中国上海销售法人  
设立日本东京办事处  
编入 KOSPI 200 指数
- 2001.09. 启动 FAB A2 Line
- 2001.07. 接管大字电子公司半导体事业部
- 1999.07. 启动第三工厂(SMD Line)
- 1997.04. 启动第二工厂  
(Wafer FAB Line 启动 - A1 Line)
- 1996.10. 股票上市
- 1996.09. 设立中国当地法人（大连）
- 1996.08. 商号变更为光电子株式会社  
韩国光电子(株)-  
吸收合并 (株) 光电子 TECHNO
- 1988.10. 附设电子研究所开业
- 1984.07. 设立 KOREA TECHNO(株)

## 受奖认证

- 2004.10. 被授予韩国产业电子配件技术大奖  
(企业奖、个人功劳奖)
- 2004.02. 获得 QS-9000 认证(AUK-D)
- 2004.02. 获得 ISO9001:2000 认证(AUK-D)
- 2003.08. 开发 Power Management IC 及  
MOSFET
- 2001.09. Power 元件战略事业化
- 2000.12. 引进 SiGe 技术  
被授予出口一亿美元大奖
- 2000.11.精密技术振兴大会  
(RF Tr 开发及超小型超轻量 Package)  
- 开发产业技术振兴院
- 2000.11. 启动 6" MOS FAB Line
- 2000.07. 获得 SMD Photo Coupler  
UL 认证
- 1999.12. 被授予出口 7,000 万美元大奖  
获得 ISO 9001/QS-9000 认证
- 1999.07. 获得 ISO 9002/QS-9000 认证  
被授予出口 5,000 万美元大奖
- 1999.03. 启动 5" Wafer FAB Line
- 1998.10. DIP/SOP IC 事业 开始投产
- 1997.04. 获得 ISO 9002 认证  
开始批量生产 SMD Transistor
- 1988.10. Transistor 事业 开始投产
- 1987.11. 被授予出口 500 万美元大奖  
开始生产 LED 及 Photo Sensor

2000

1990

1980